水溶液中における不均一金属表面の電位・電流分布

金児紘征*

Potential and Current Distributions on Inhomogeneous Surfaces of Metallic Materials in Aqueous Solutions

Hiroyuki KANEKO*

Key Words : Corrosion Monitoring, Galvanic Corrosion, Potential-Current Distribution

金属表面はさまざまの原因により電位分布が一様とならず腐食が進行する。ここでは、具体例として 銅-亜鉛ガルバニ腐食系をとりあげ、腐食のその場測定としての電位・電流分布測定法および得られた 結果について解説する。

1. はじめに

水溶液中に浸せきした金属表面は種々の理由により, 化学的または物理的に不均一であるため、アノード(低 電位部)とカソード(高電位部)の間に局部電池が形成 され電気化学的腐食が進行する。この場合、電位分布を 測定すれば測定電位の高低から、アノードとカソードの 位置を検出することができ、電流分布を測定すれば試料 各部の腐食速度を解析できるため、腐食の進行状態を総 合的に検討できる。ただし、局部電池が生じて腐食が進 行する場合、局部電流が流れて分極し、できるだけ電位 分布が一様になろうとする傾向があるため、一般には試 料各部の電位差は極めて小さく、その測定と解析には種々 の困難が伴う。このような観点から、電位・電流分布の 理論的解析法が進み、また、測定法が発展してきた。こ こでは、この腐食の形態を明らかにするため、典型的な 腐食例として銅-亜鉛ガルバニ腐食系をとりあげ、その 電位分布、電流分布の測定法および測定したそれらの分 布に及ぼす諸因子の影響について解説する。

2. 電位・電流解析法

ここでは電位分布測定法の理論的基礎を示す¹⁾。図1 に分極の概念図を示す。(i)の抵抗分極のない場合に は腐食電流(I_{corr})が流れて分極し,r / - r電位(ϕ_a) とカソード電位(ϕ_c)は一致し,一定の腐食電位(ϕ_{corr}) を示す。したがって,この場合,r / - rとカソードを 電位的に区別しえないため,電位分布から試料各部の微



図1 分極曲線模式図

 (i) IR 降下が無視できる場合(均一電位分布)
 (ii) IR 降下が無視できない場合(不均一電位分布)

視的な電気化学的特性を明らかにすることはできない。 この腐食電位はアノード面積(A。)とカソード面積 (A。)の面積比により変化する。i., i. をそれぞれアノー ドおよびカソード電流密度とすれば,

 $\phi_{\text{corr}} = \phi_{a} (I_{\text{corr}}/A_{a}) = \phi_{c} (-I_{\text{corr}}/A_{c})$

 $I_{\rm corr} = i_{\rm a}A_{\rm a} = -i_{\rm c}A_{\rm c}$

の関係が得られる。ここでは簡単のため、分極の程度が 小さいとしてつぎの直流分極を仮定して説明する。

$$\phi_{a} = \phi_{a}^{\circ} + \lambda_{a} \iota_{a}$$
$$\phi_{c} = \phi_{c}^{\circ} + \lambda_{c} \iota_{o}$$

1

ここで、 ϕ_{a}° 、 ϕ_{c}° は分極していないときのアノードお よびカソード電位で、 λ_{a} 、 λ_{c} は分極の程度を表すパラ メータである。これらの関係から、

^{*}秋田大学鉱山学部(〒010 秋田県秋田市手形学園町1-1) Mining College, Akita Univ. (1-1, Tegata-Gakuencho, Akita-shi, Akita 010)

説

解

$$\phi_{\text{corr}} = \frac{\frac{\lambda_a + \lambda_c}{\lambda_a} A_a \phi_a^{\circ} + \frac{\lambda_a + \lambda_c}{\lambda_c} A_c \phi_c^{\circ}}{\frac{\lambda_a + \lambda_c}{\lambda_a} A_a + \frac{\lambda_a + \lambda_c}{\lambda_c} A_c}$$

が得られる。このことから、アノードおよびカソードの 実面積をおのおのの分極パラメータの比で割った値を有 効面積とすれば、求める ϕ_{corr} は面積比に応じて $\phi_{\mathfrak{s}}^{\circ}$ と $\phi_{\mathfrak{s}}^{\circ}$ の相加平均になる。カソード支配型分極特性で $i_{\mathfrak{s}}$ の 電位依存性がほとんどなく、一定値 $i_{\mathfrak{s}}^{\circ}$ であるとすると、

$$\dot{i}_a = -i_c^{\circ} \frac{A_{\circ}}{A_a}$$

となり,面積比に比例するが, この関係は Catchment 原理²⁾として知られている。

(ii)の抵抗分極のある場合,その抵抗をRとすれば,
 d. (*L*₁-/*A*.)+*L*₁-*R*=*d*. (-*L*₁-/*A*.)

$$\phi_{c} - \phi_{a} = \frac{\phi_{c}^{\circ} - \phi_{a}^{\circ}}{1 + \frac{\lambda_{a} + \frac{A_{a}}{A_{c}} \lambda_{c}}{A_{a}R}}$$

となり,

 $A_{a}R \rightarrow \infty : \phi_{a} \rightarrow \phi_{a}^{\circ}, \phi_{c} \rightarrow \phi_{c}^{\circ}$

 $A_{a}R \rightarrow 0 : \phi_{c} \rightarrow \phi_{a}$

である。この場合,電位測定すれば,電位の低い部位が アノードで電位の高い部位がカソードであるが,分極に よって実際の電位差は開回路電位差 $\phi_{s}^{o} - \phi_{s}^{o}$ に比べて 極めて小さくなる。電位分布から,

 $i = \sigma E$

 $= -\sigma$ grad ϕ

の関係を用いて電流分布が求まる。ここで、σは比伝導 度である。これらのことから、電位分布測定によってア ノード、カソード部位の確認および局部腐食電流の解析 が可能となる。ここでの取り扱いでは、抵抗 R はアノー ドとカソードの全抵抗としたが、このように場所場所の 電位分布に立ち入らずに全腐食電流を求めるのは有効な 方法であり、Mansfeldら²⁾によって発展した。しかし、 微視的な電位分布を考察するためには境界条件を与えて Laplaceの方程式を直接解かなければならない。この 際、境界における電位または電流をあらかじめ独自に設 定して計算する通常の電気工学の場合とは異なり、境界 で局部腐食電流と電位の間の関係すなわち分極曲線が分 かっていると仮定して解かねばならないという特殊性が ある³)。その解析例として、Waber⁴)によるフーリエ級 数法および Wagner⁵⁾による複素積分法,さらに最近で は Smyrl と Newmann による差分法⁶⁾または有限要 素法")による解法があるが、その詳細については割愛す る。



図2 電位・電流分布測定システムのブロック図

3. 電位・電流分布測定法とその応用

試料各部の電位・電流分布測定装置は腐食検出のその 場観察装置であるため Corrdescope と称されるが⁸⁾, ルギン管センサーの掃引に関しては手動で駆動するもの から、自動駆動するもの、電位の測定についてはアナロ グ的なものからデジタル測定するものに至る発展の歴史 がある。また、試料形状により円筒試料用と平面試料用 のものがある。円筒試料用測定装置は試料を回転させ, センサーを上下に駆動させる形式のもので試料面の電位 分布を迅速測定できる利点があるが最近はあまり用いら れていない")~13)。ここではデジタル測定による平面試料 用自動測定装置の測定法を図2に示す。この測定システ ムは平面試料面上をルギン管が前後、左右に駆動し、マ イクロコンピュータを用いて測定電位分布図をオンライ ンで作製、解析するためのものである。ルギン管が上下 (Z軸)には手動,前後(X軸),左右(Y軸)にはパル スモーターで微動できるようになっており、マイクロコ ンピュータからの指令により自動的に X方向へ掃引し た後にY方向に一定距離だけ微動し、再びX方向へ掃 引する操作を繰り返して決められた試料面を掃引する。 X、Y変位はポテンショメータを経由し、また測定電位 はインピーダンス変換器を経由し、AD変換した後にオ ンラインでマイクロコンピュータに入力する。電位分布 作製部はマイクロコンピュータ、ディスプレー、プリン ター、フロッピーディスクからなる。マイクロコンピュー タからの指令に基づいてデータを取り込み、測定データ をフロッピーディスクに格納し、のちに三次元表示法、 濃淡表示法、等電位表示法により表示する。

電位分布測定法の有効性を立証するため、銅板上に中 心間距離8mm離して4mm径の亜鉛を2箇所溶着した 試料を0.01mol・dm⁻³NaCl溶液中に浸せきし、測定 した結果を図3に示す。亜鉛部は電位が低くアノードで、 銅部は電位が高くカソードであるが、見やすくするため



図3 Cu-Znガルバニ対の形態と電位分布図(0.01mol・dm⁻³NaCl, 25℃) (a) 形態,(b) 3 次元表示,(c) 濃淡表示,(d) 等電位表示



図4 図3の試料に対する電流分布図 (a)水平電流成分,(b)垂直電流成分,(c)全電流, (d)アノード電流分布図

にアノードを三次元表示法では上方にし,濃淡表示法で は明部として示した。図3(a)から明らかなように,銅 / 亜鉛境界から腐食しているが,銅/ 亜鉛境界のうち亜 鉛の向かい合う側より逆側の方が腐食が激しい。電位分 布図を見ると,腐食の激しい部分は電位勾配が急な部分 に対応している。測定結果の表示法として,三次元表示 法は定性的な電位分布図として,濃淡表示法は時々刻々 の定性的な電位分布変化図として,また,等電位線表示 法は定量的な電位分布図として有効であるため使い分け ると便利である。原理的には、ペンレコーダを用いるア ナログ測定でも三次元表示することができるが¹⁵,隠れ 線処理ができるのがコンピュータによるデジタル測定の 長所である。ここで示した図は、パーソナルコンピュー タが出始め、マイコンによるデータ処理が話題になり始 めた頃、筆者が製作した装置によって得られたものであ り、画素は非常に粗く、その処理速度は遅かったが、近 年のコンピュータ技術の進歩により、現在では極めて精 密な濃淡表示、等電位線表示が高速で可能となり、これ らの表示法は従来にも増して有効性が高まっている。

電流分布を測定するためには白金などの金属電極を圧

解

説

電アクチュエーターで上下に入って振動数で振動させて, その間の電位勾配を測定する振動電極法が最近開発さ れ^{17), 18)},製品化もされているが,ここでは測定原理を 明らかにするために、上下に一定距離ルギン管距離をず らせた2ルギン管法で得られた結果19)を図4に示す。電 流密度(i) と電位(ϕ)の間にはオームの法則 $i = -\sigma$ $grad \phi が 成立 するとして解析した。ここで、 <math>\sigma は バ \mu$ ク溶液の電気伝導度で、0.119S・m⁻¹(0.01mol・dm⁻³ NaCl)を用いた。電流密度は水平分布は溶着した亜鉛 の中心部とそれらの中間の銅部で最も小さくなり、亜鉛 周辺部で極大値を示し、その位置は亜鉛/銅境界に対応 した。電流密度の垂直成分は、その符号からアノード電 流かカソード電流か判断することができ、アノード電流 の垂直成分も亜鉛中心部より周辺部で大きくなっていた。 全電流密度を解析すると、銅/亜鉛境界のうち、亜鉛の 向かい合う側よりも逆側の方がアノード電流が大きく, 実際の腐食とよく対応していた。ただし、測定から求め たアノード領域は、試料に対して0.5mm離れた位置の ルギン管による値であったため、亜鉛の実寸法より大き な円となった。この測定法は局部腐食モニターとして有 効であり,電位・電流測定は溶接試料の熱影響部腐 食20,21,めっき鋼板欠陥部22,粒界腐食23~25,塗装部 の腐食²⁶⁾などの検出に用いることができる。また、金属 電極を用いて複素インピーダンス分布を調べた例^{27,28)} もあり、pHセンサーを用いてそれらの分布を測定でき る可能性もある。なお、どれだけ測定分解能を上げられ るかはセンサーの微動駆動と微少電位差測定技術による が、電位・電流分布が時々刻々変化しているため、デジ タル測定した個々のデータの信頼性よりは測定所用時間 を短縮することが重要である。

4. 電位分布に及ぼす諸因子の影響

妥当な電位・電流分布測定を行うには、電位・電流分 布に影響する因子を知る必要があるが、電位・電流分布 は実に種々の条件により変化する。これまで多くの系で さまざまな実験条件で電位・電流分布測定がなされてい るが^{29)~32)},諸因子の影響についてまとまった検討がな されていない。ここでは、筆者の研究室において、銅の 一部に亜鉛めっきした図5に示す試料について種々の条 件で電位分布を調べた結果について述べる。

測定溶液は25℃に保持した空気飽和の NaCl 溶液で, 試料を溶液に浸せきし,通常,試料面上の電解質厚さを 20mmに固定した。電位分布測定には2ルギン管法を用 いた。電位は Ag/AgCl (飽和 KCl) 電極を基準にし て測定した。1本のルギン管は銅部上の●印の点に固定 されており,安定した電位が得られることを確認した後, 試料-ルギン管距離を0.1mm間隔で1mmまで,その 後は 1.2, 1.5, 2, 3,4 mmと変化させて同様の測定





図6 銅と亜鉛の分極曲線

を繰り返した。測定パラメーターとして溶液濃度, 亜鉛 /銅面積比, 電解質厚さを選んだ。

4.1 銅-亜鉛の分極曲線

0.1mol・dm⁻³ NaCl 中における分極曲線を図6 に 示す。亜鉛はほとんど分極されず一定電位で、銅は著し く分極されるが、分極電流は電位に関係なくほぼ 0.05 mA・cm⁻²で一定であった。したがって、銅-亜鉛ガ ルバニ対は典型的なカソード支配型の腐食である。

4.2 基礎理論

Wagner⁴は**図7**に示すような境界条件でLapalce の方程式を解き,つぎの解析解を得た。

$$\phi = \frac{J_{\text{c(max)}}}{\sigma} \left\{ y + \frac{(a+c)}{\pi} \operatorname{Re} \left[i \sin^{-1} \frac{\sin \{\pi (x+iy)/(a+c)\}}{\sin \{\pi a/2 (a+cs)\}} \right] \right\}$$

-12-

水溶液中における不均一金属表面の電位・電流分布







図8 電位分布 (a) 測定値,(b) 計算値

ここで、 $J_{c(max)}$ は拡散限界電流、 σ は比伝導度である。 電解質 $0.1 \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ NaCl, 亜鉛/銅面積比 0.067, 電解質厚さ 20 mmにおける電位分布の測定値を図 8 (a) に、また、対応した計算値を図 8 (b) に示す。計算結果 は測定値とよく一致している。

Wagner の理論式によれば、溶液濃度を変化させて も電位の分布は相似で、相似比は $J_{c(max)}/\sigma$ である。ま た、亜鉛/銅面積比が小さくなるほど銅と亜鉛の電位差 は大きくなると推定される。なお、Wagner の理論式 は電解質厚さを無限大と仮定しているため、電解質厚さ の影響を解析することはできない。

4.3 溶液濃度の影響

NaCl 濃度を1, 0.1, 0.05, 0.01mol・dm⁻³ にした 時の電位分布図の比較を図9に示す。 1 mol・dm⁻³ NaCl中では銅と亜鉛の電位差は1 mV以下で, ほとん ど等電位であるが, 0.01mol⁻³ NaCl中では60mV あ り, 0.001, 0.0001mol・dm⁻³ NaCl中ではそれぞれ 200, 500mVに達する。これらの効果の概略は Wagner の理論式で予測した結果とほぼ一致する。

4.4 亜鉛/銅面積比の影響

0.1mol・dm⁻³ NaCl中で亜鉛めっき幅を0.5, 1, 2,



-13-

8mmにしたときの電位分布図の比較を図10に示す。亜 鉛/銅面積比が1のときはほぼ等電位であるが、亜鉛/ 銅面積比が小さくなるほど銅と亜鉛の電位差は大きくな る。これは亜鉛部が小さくなるほど分極電流の到達域が 狭くなるためである。したがって、亜鉛/銅面積比が小 さくなるほど、かえって電位分布による亜鉛部の検知が



図10 電位分布に及ぼす Cu/Zn 面積比の影響(単位mV) ●印位置の電位:(a)-962,(b)-963,(c)-964, (d)-969mV



解

容易となる。これとは逆に亜鉛の中に銅がわずかに含ま れている場合は、銅が完全に分極されて電位分布が一様 になるため、銅部の検知が極めて困難となる。このこと は理論的にも証明されている⁸³。

4.5 電解質厚さの影響

0.01mol・dm⁻³ NaCl 中で電解質厚さを0.5, 1mm にしたときの電位分布図の比較を図11に示す。電解質厚 さ 20mmの結果を先に図8に示したが,電解質厚さが 5 mm以上ではほとんど電位分布は変化せず, 銅と亜鉛 の電位差は60mV程度である。電解質厚さが2 mm以下 になると銅と亜鉛の電位差は大きくなり,0.5mmでは 200mVに達し,等電位線はほとんど垂直になる。なお, 電解質厚さが薄くなるほど全体として電位が高くなる傾 向がある。また,試料がわずかに濡れている極端な状態 ではほとんど分極せず,その場所場所の電極電位を測定 することができる。極端な例としてセンサーの先端に液 滴をつけて掃引して電極電位を測定することもできる³⁰。

上記の結果から,銅-亜鉛ガルバニ対の電位分布は溶 液濃度が低いほど,亜鉛/銅面積比が小さいほど,また, 電解質厚さが薄いほど不均一になりやすい,すなわち局 部腐食性が大きいことを示している。さらに,外部電源 を用いて微弱なアノード電流を通電すれば,局部腐食傾 向が増し,検出しやすくなることが予想できる^{10, 35)}。

この電位分布から、電流分布を解析すると腐食電流密 度を算出することができる。しかし、通常、溶液組成を 一定として解析するとカソード電流のほうがアノード電 流より大きくなり、詳細に検討するためには、さらに試 料表面における濃度分布を考慮する必要がある。そこで、 試料表面における pH分布を調べるため、水溶液にあら



水平距離/mm

図11 電位分布に及ぼす電解質厚さの影響(単位mV) ●印位置の電位:(a)-898, (b)-856, (c)-776mV

Vol.44, No.9, 1993

かじめフェノールフタレインを添加し,溶液の着色変化 を観察すると⁸⁰,銅部と亜鉛部の境界より銅部側に白い 薄膜が広がり,その内側の亜鉛部は無色で,その外側の 銅部は赤色に着色した。このことは,亜鉛部では亜鉛イ オンの溶出のために酸性になり,銅部では酸素の還元反 応によりアルカリ性となり,その境界域では亜鉛水酸化 物が析出して腐食が進行することを示している。また, 電位端子,電流端子をもつ白金4端子による水溶液の電 気抵抗分布を測定すると,亜鉛上部で電気抵抗が小さく なっていた。このことも亜鉛部で亜鉛イオンが溶出して いることを示している。

以上のことから,腐食が進行しているときの水溶液濃 度分布,pH分布,電位・電流分布の間には相互に関連 があり,一連の測定,解析は水溶液中での金属表面の腐 食現象の総合的理解に極めて有効である。

5. おわりに

局部腐食をモニターするための電位,電流分布測定法 について解説し,銅-亜鉛ガルバニ腐食系についてその 有効性を確めた。また,ここでは言及しなかったが,こ こで示した解析法,測定法は,試料の腐食のみならず, 電析または電解研磨の精密制御にも応用できる^{sr)}。さら に,センサーを試料に近づけていけば,この測定法は結 局のところ走査トンネル顕微鏡に行き着く。したがって, この電位・電流分布測定法は今後ますます応用範囲が広 がるものと思われる。

(1993-5-13 受理)

文 献

- 1) 金児紘征;日本金属学会誌, 42, 381 (1978)
- 2) F. Mansfeld; Corrosion, 37, 436 (1971)
- 3) G. A. Prentice and C. W. Tobias ; J. Electrochem. Soc.,
 129, 72 (1982)
- 4) J. T. Waber; J. Electrochem. Soc., 101, 271 (1954); 102, 344 (1955); 102, 420 (1955); 103, 64 (1956); 104, 138 (1956); 103, 567 (1956)

E. Kennard and J. T. Waber ; J. Electrochem. Soc., 117, 880 (1970)

- 5) C. Wagner; J. Electrochem. Soc., 99, 1 (1952); 104, 631 (1957); 107, 445 (1960)
- 6) W. H. Smyrl and J. Newmann; J. Electrochem. Soc., 123, 1433 (1976)
- 7) R. S. Munn and O. F. Devereux ; Corrosion, 47, 618

(1991)

- 8) K. J. Bhansali and M. T. Hepworth ; Sci. Inst., 7, 681 (1974)
- 9) J. B. McAndrew, W. H. Colner and H. T. Francis; NACE Tech. Note, 2523 (1951); *Chem. Eng.*, 59, 305 (1962)
- 10) J. M. Miller and H. T. Francis; ARF-2181-12 (1962)
- R. R. M. Johnston, C. P. Lloyd and N. White; Australasion Corr. Eng., 1973, 7 (July, 1973)
- 12) L. J. Geiner and G. R. Wallwork ; Corrosion, 35, 61 (1979)
- 13) 金児紘征, 鎌田宏之; 日本金属学会誌, 46, 387 (1982)
- 14) 金児紘征, 泰松 斉; 日本金属学会誌, 47, 501 (1983)
- 15) H. S. Isaacs and B. Vyas; ASTM STP, 727 (1979)
- 16) H. S. Isaacs; Locarized Corrosion, Ed. by B. F. Brown, J. Kruger and R. W. Staehle, National Association of Corrosion Engineering (NACE), Houston, p.158 (1974)
- 17) 石川雄一, H. S. Isaacs; 防食技術, 33, 147 (1984)
- 18) H. S. Isaacs and Y. Ishikawa; Corrosion 85, paper Na55, NACE (1985)
- 19) 金児紘征, 泰松 斉; 日本金属学会誌, 48, 191 (1984)
- G. C. Savva, G. C. Weathely and K. T. Aust; Corrosion, 45, 243 (1989)
- 21) B. Vyas and H. S. Isaacs; ASTM STM, 656 (1977)
- 22) H. S. Isaacs; Corrosion, 43, 594 (1987)
- 23) 篠原 正, 尾崎孝一, 辻川茂男; 防食技術, 39, 688 (1990)
- 24) R. B. Mears and R. H. Brown ; Indust. Eng. Chem., 33, 1001 (1941)
- 25) H. Grubrich and A. Zirkl ; Werkstoffe und Korrosion,33, 565 (1972)
- 26) W. G. O'Drisoll; J. Iron and Steel Inst., 353 (1951)
- 27) J. Standish and H. Leidheiser Jr.; Corrosion, 36, 390 (1980)
- 28) H. S. Isaacs and M. W. Kendig ; Corrosion, 36, 269 (1980)
- N. D. Tomashov ; Theory of Corrosion and Protection of Metals, Macmillan Co., New York, p.161 (1966)
- 30) I. L. Rosenfield and I. S. Danilov ; Corrosion Sci., 7, 129 (1967)
- 31) W. Jaenicker and K. F. Bonhoeffer; Z. Physik. Chem., A190, 193 (1942); 193, 302 (1944)
- 32) V. S. Daniel-Bek ; *Zhur. Fiz. Khim.*, 15, 382 (1941) ;
 18, 247 (1944) ; 20, 567 (1946)
- 33) B. Levitch and A. Frumkin ; Acta Physicochim. U. R. S.
 S., 18, 325 (1943)
- 34) 金児紘征;秋田大学鉱山学部報告, 4, 53 (1984)
- 35) 金児紘征;日本金属学会秋期大会講演概要, p.334(1982)
- 36) H. Hildebrand and W. Schwenk ; Werkstoffe und Korrosion, 23, 364 (1972)
- 37) R. Santebin, H. Froideraux and D. Landolt ; J. Electrochem. Soc., 127, 1096 (1980)